

意匠委員会

2007年度の活動

<第1ワーキング>

■ 企業活動に貢献するための知財(意匠)活動のあり方の研究

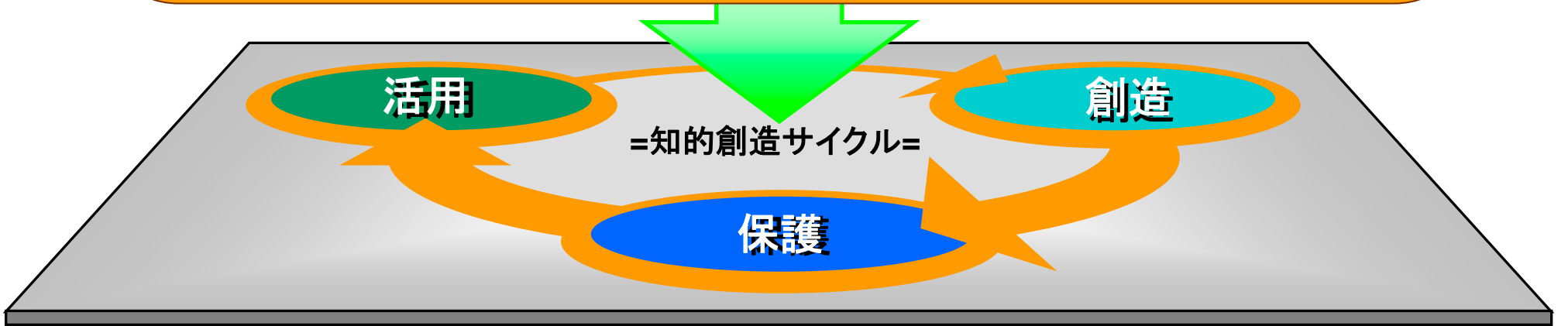
- ・ 先手必勝の知財戦略
- ・ 判例から得られる類否判断基準
- ・ 他法との相違点と意匠権のメリット/デメリット

<第2ワーキング>

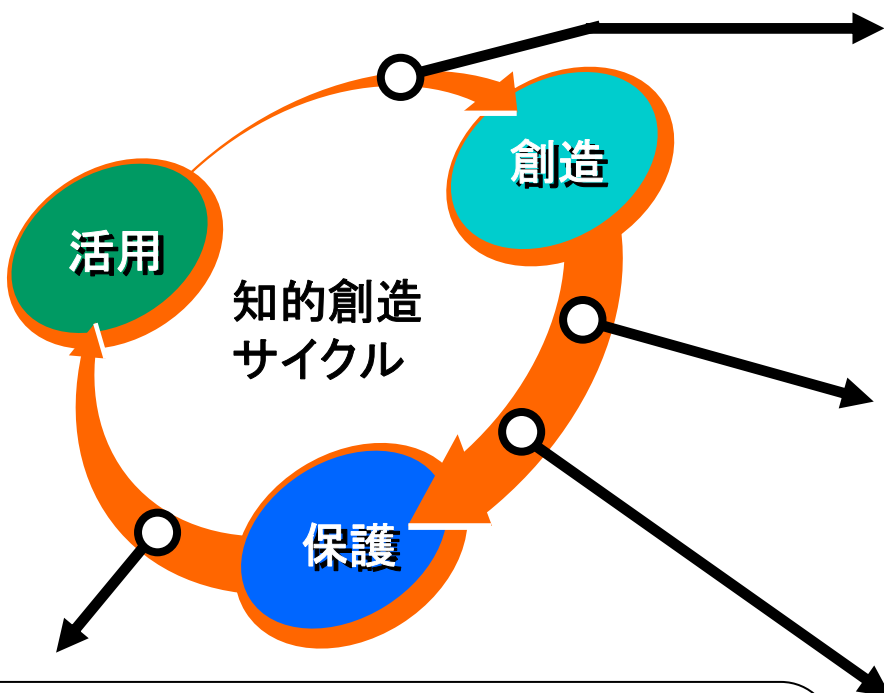
■ 国内外制度の調査研究
■ 法改正・運用改善への具体的な提言

- ・ 中国専利法、実施細則の改正
- ・ 画像デザインに関するガイドライン
- ・ タイプフェイス保護の検討 etc

「知的創造サイクル」の中で企業活動に貢献する意匠業務の在り方の提案



「知的創造サイクル」の各フェーズにおける意匠調査



ウォッチング

目的： 出願動向・デザイン動向チェック
対象国： 主要国
ツール： 各国IPDL（登録意匠）
カタログ/雑誌/Web（公知意匠）

侵害性調査 =他社権利侵害の回避=

目的： 他社類似意匠有無チェック
対象国： 自社製品の生産国、販売国etc
ツール： 各国IPDL（登録意匠）
カタログ/雑誌/Web（公知意匠）

権利範囲調査 =活用に向けて=

目的： 権利範囲確認、無効原因の有無確認
対象国： 権利行使を行う国etc
ツール： 各国IPDL（登録意匠）
カタログ/雑誌/Web（公知意匠）

登録性調査 =自社権利網の構築=

目的： 新規性・創作性チェック
対象国： 出願予定国etc
ツール： 各国IPDL（登録意匠）
カタログ/雑誌/Web（公知意匠）

いずれの意匠調査においても各国IPDLを利用可能

主要各国の“IPDL(電子図書館)”

【日本】

出力一覧

書誌事項

代表図

<http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl>

【中国】

出力一覧

詳細画面

<http://www.sipo.gov.cn/sipo/>

【韓国】

出力一覧

詳細画面

代表図面のみの一覧

<http://eng.kipris.or.kr/>

【EU】

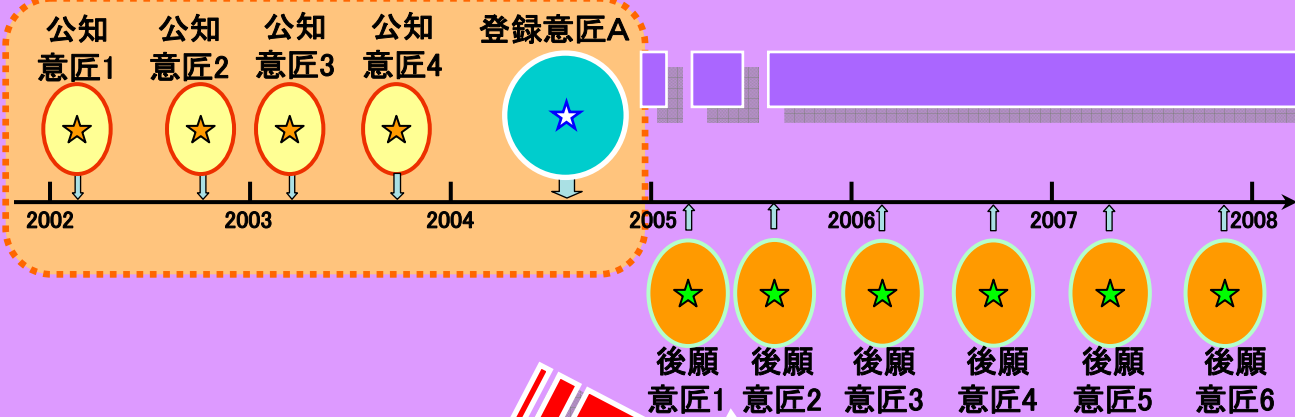
出力一覧

詳細画面

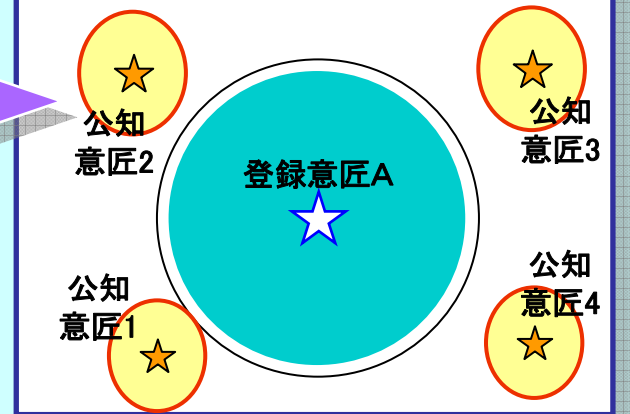
<http://oami.europa.eu/en/default.htm>

マッピングによる調査結果の分析

【タイムチャート】

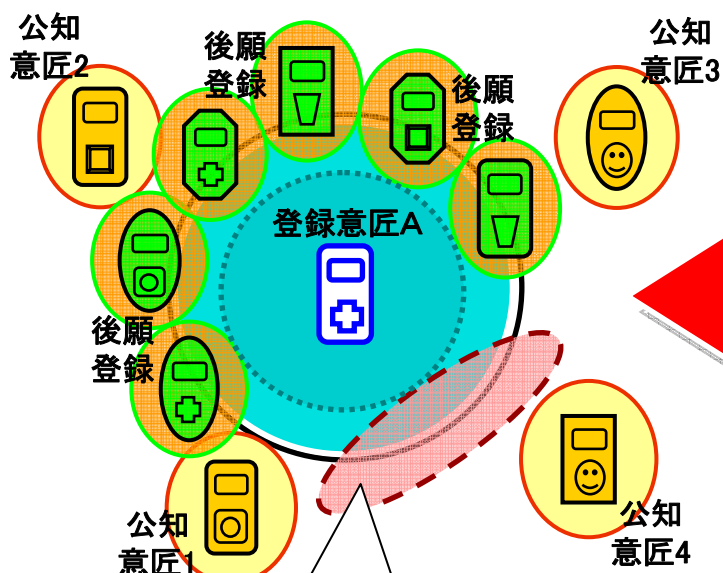


【登録意匠Aの当初の権利範囲】



【登録意匠Aの実質的な権利範囲】

非類似臨界での後発意匠の発生
⇓
類似範囲が実質的に狭小化



後発意匠のスキマ

【マトリクス】

後願登録意匠	後願登録意匠	公知意匠3
公知意匠1	登録意匠A	公知意匠2
後願登録意匠	公知意匠2	公知意匠4
後願登録意匠	後願登録意匠	後願登録意匠

後発意匠のスキマ